

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 5 部門第 1 区分

【発行日】平成27年5月28日 (2015.5.28)

【公開番号】特開2013-221414(P2013-221414A)

【公開日】平成25年10月28日 (2013.10.28)

【年通号数】公開・登録公報2013-059

【出願番号】特願2012-91710(P2012-91710)

【国際特許分類】

F 0 1 N 3/28 (2006.01)

B 0 1 J 33/00 (2006.01)

B 0 1 D 53/86 (2006.01)

【 F I 】

F 0 1 N 3/28 3 1 1 P

F 0 1 N 3/28 Z A B

B 0 1 J 33/00 G

B 0 1 D 53/36 C

【手続補正書】

【提出日】平成27年4月13日 (2015.4.13)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

処理構造体と、

前記処理構造体を収容する金属製のケーシングと、

前記処理構造体と前記ケーシングとの間に配置される無機繊維製の保持材と、

を備えた気体処理装置を使用して気体を処理する方法であって、

前記保持材と前記ケーシングとの間に、有機高分子を、前記気体の処理中に前記保持材の外表面及び前記ケーシングの内表面と接するように配置し、

前記ケーシングの温度が、前記有機高分子の軟化温度以上、前記有機高分子の分解温度未満である条件で、前記気体を処理する

ことを特徴とする気体処理方法。

【請求項 2】

前記気体の処理中における前記ケーシングの温度は、60 以上、500 以下であることを特徴とする請求項 1 に記載の気体処理方法。

【請求項 3】

前記ケーシングを冷却することにより、前記ケーシングの温度が、前記有機高分子の軟化温度以上、前記有機高分子の分解温度未満に調節された前記条件で、前記気体を処理する

ことを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の気体処理方法。

【請求項 4】

処理構造体と、前記処理構造体を収容する金属製のケーシングとを備えた気体処理装置において、前記処理構造体と前記ケーシングとの間に配置される無機繊維製の保持材であって、

その外表面に、前記気体処理装置を使用した気体の処理中の前記ケーシングの温度以下の軟化温度と、前記気体の処理中の前記ケーシングの温度より高い分解温度とを有する有

機高分子が、前記気体の処理中に前記ケーシングの内表面と接するように配置されていることを特徴とする気体処理装置用保持材。

【請求項 5】

処理構造体と、

前記処理構造体を収容する金属製のケーシングと、

前記処理構造体と前記ケーシングとの間に配置される無機繊維製の保持材と

を備えた気体処理装置であって、

前記保持材と前記ケーシングとの間に、前記気体処理装置を使用した気体の処理中の前記ケーシングの温度以下の軟化温度と、前記気体の処理中の前記ケーシングの温度より高い分解温度とを有する有機高分子が、前記気体の処理中に前記保持材の外表面及び前記ケーシングの内表面と接するように配置されている

ことを特徴とする気体処理装置。

【請求項 6】

処理構造体と、前記処理構造体を収容する金属製のケーシングとを備えた気体処理装置において、前記処理構造体と前記ケーシングとの間に配置される無機繊維製の保持材を製造する方法であって、

前記保持材の外表面に、前記気体処理装置を使用した気体の処理中の前記ケーシングの温度以下の軟化温度と、前記気体の処理中の前記ケーシングの温度より高い分解温度とを有する有機高分子を、前記気体の処理中に前記ケーシングの内表面と接するように配置する

ことを特徴とする気体処理装置用保持材の製造方法。

【請求項 7】

前記気体の処理中の前記ケーシングの温度を決定すること、

決定された前記ケーシングの温度以下の軟化温度と、決定された前記ケーシングの温度より高い分解温度とを有する前記有機高分子を選択すること、及び

選択された前記有機高分子を、前記気体の処理中に前記ケーシングの内表面と接するように、前記保持材の外表面に配置すること

を含む

ことを特徴とする請求項 6 に記載の気体処理装置用保持材の製造方法。

【請求項 8】

処理構造体と、

前記処理構造体を収容する金属製のケーシングと、

前記処理構造体と前記ケーシングとの間に配置される無機繊維製の保持材と

を備えた気体処理装置の製造方法であって、

前記保持材と前記ケーシングとの間に、前記気体処理装置を使用した気体の処理中の前記ケーシングの温度以下の軟化温度と、前記気体の処理中の前記ケーシングの温度より高い分解温度とを有する有機高分子を、前記気体の処理中に前記保持材の外表面及び前記ケーシングの内表面と接するように配置する

ことを特徴とする気体処理装置の製造方法。

【請求項 9】

前記気体の処理中の前記ケーシングの温度を決定すること、

決定された前記ケーシングの温度以下の軟化温度と、決定された前記ケーシングの温度より高い分解温度とを有する前記有機高分子を選択すること、及び

選択された前記有機高分子を、前記気体の処理中に前記保持材の外表面及び前記ケーシングの内表面と接するように、前記保持材と前記ケーシングとの間に配置すること

を含む

ことを特徴とする請求項 8 に記載の気体処理装置の製造方法。